



## Disolventes para LC-MS

En la actualidad, la técnica LC-MS está siendo utilizada por un número cada vez mayor de laboratorios de investigación y de análisis en diferentes áreas de la industria (laboratorios medioambientales, farmacéuticos y biotecnológicos).

**Su elevada sensibilidad y selectividad la hacen idónea para la identificación y cuantificación de multitud de compuestos en las matrices más complejas.**

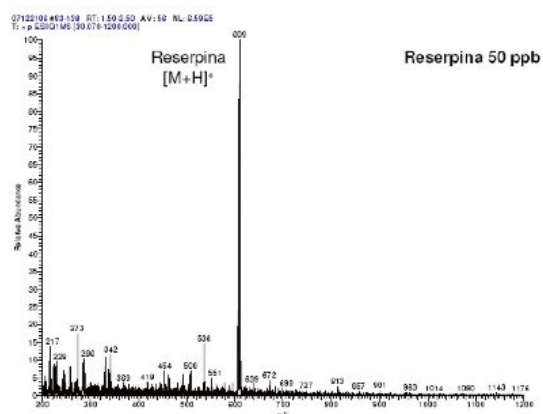
**PanReac AppliChem ofrece, dentro de su línea de productos para HPLC, la gama de disolventes LC-MS que satisfacen las exigencias de esta moderna técnica:**

**Muy baja concentración (<100 ppb) de metales.**

**Bajo contenido de partículas debido a la microfiltración (con filtro de 0,2 µm de poro).**

**Aptitud LC-MS:** ninguna señal resulta mayor que el pico molecular de la reserpina (609 amu) a la concentración de 50 ppb, en un intervalo de 200 a 2000 amu.

**Elevada transmitancia al UV y una excelente línea de base durante la prueba de gradiente con HPLC.**



Código de producto	Nombre de producto	Nº CAS	Tamaño de envase
701881.1611	Acetonitrilo para LC-MS	75-05-8	1 L
701881.1612			2,5 L
701091.1611	Metanol para LC-MS	67-56-1	1 L
701091.1612			2,5 L
701074.1611	Agua para LC-MS	7732-18-5	1 L
701074.1612			2,5 L

	Acetonitrilo (LC-MS)	Metanol (LC-MS)	Agua (LC-MS)
Código de producto	701881	701091	701074
Identidad	IR s/e	IR s/e	
Densidad a 20/4	0,779-0,783	0,791-0,792	
Color APHA	≤ 10	≤ 10	
Riqueza mínima (C.G.)	≥ 99,9%	≥ 99,9%	
Residuo fijo	≤ 0,0001%	≤ 0,0002%	≤ 0,0001%
Acidez	≤ 0,0003 meq/g	≤ 0,0002 meq/g	
Alcalinidad	≤ 0,0001 meq/g	≤ 0,0002 meq/g	
Agua	≤ 0,01%	≤ 0,02%	
Cloruro (Cl)			≤ 0,000001%
Fluoruro (F)			≤ 0,000001%
Nitrato (NO <sub>3</sub> )			≤ 0,00001%
Sulfato (SO <sub>4</sub> )			≤ 0,00001%
Deriva de la línea base (210 nm)	10 mUA		
Deriva de la línea base (235 nm)		15 mUA	
<b>Gradiente</b>			
<b>A (mUA)</b>			
a 210 nm	≤ 1		≤ 5
a 235 nm		≤ 2	
a 254 nm	≤ 0,2	≤ 1	≤ 0,5
<b>Transmitancia UV (camino óptico: 1cm; referencia: agua)</b>			
a 190 nm	≥ 30 %		
a 193 nm	≥ 60 %		
a 195 nm	≥ 80 %		
a 200 nm	≥ 90 %		≥ 98 %
a 205 nm (cut off)		≥ 10 %	
a 210 nm		≥ 30 %	≥ 98 %
a 220 nm		≥ 60 %	
a 230-400 nm	≥ 98 %		
a 230 nm		≥ 80 %	
a 240 nm		≥ 90 %	
a 254 nm			≥ 99 %
a 260-400 nm		≥ 98 %	
a 300-450 nm			≥ 99 %
<b>Fluorescencia</b>			
<b>Referencia: Quinina</b>			
a 254 nm	≤ 1 ppb	≤ 1 ppb	≤ 1 ppb
a 365 nm	≤ 0,5 ppb	≤ 0,5 ppb	≤ 0,5 ppb
<b>Aptitud LC-MS</b>			
<b>TIC 200-2000 m/z ESI (+). Referencia: 50 ppb reserpina</b>			
Impurezas sensibles	≤ 100 ppb	≤ 200 ppb	≤ 200 ppb
<b>Metales</b>			
Plata (Ag)	0,05 ppm	0,05 ppm	0,1 ppm
Aluminio (Al)	0,5 ppm	0,5 ppm	0,5 ppm
Bario (Ba)	0,1 ppm	0,1 ppm	0,1 ppm
Calcio (Ca)	0,05 ppm	0,1 ppm	0,1 ppm
Cadmio (Cd)	0,05 ppm	0,05 ppm	0,05 ppm
Cobalto (Co)	0,02 ppm	0,02 ppm	0,02 ppm
Cromo (Cr)	0,02 ppm	0,02 ppm	0,02 ppm
Cobre (Cu)	0,02 ppm	0,01 ppm	0,02 ppm
Hierro (Fe)	0,1 ppm	0,1 ppm	0,1 ppm
Potasio (K)	0,1 ppm	0,1 ppm	0,1 ppm
Magnesio (Mg)	0,1 ppm	0,1 ppm	0,1 ppm
Manganeso (Mn)	0,02 ppm	0,01 ppm	0,02 ppm
Sodio (Na)	0,1 ppm	0,1 ppm	0,1 ppm
Níquel (Ni)	0,02 ppm	0,02 ppm	0,02 ppm
Plomo (Pb)	0,1 ppm	0,02 ppm	0,1 ppm
Estaño (Sn)	0,1 ppm	0,1 ppm	0,1 ppm
Zinc (Zn)	0,1 ppm	0,1 ppm	0,1 ppm

Producto microfiltrado (0,2 µm) y envasado bajo atmósfera de argón

IP-005ES

